

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 1 区分

【発行日】平成 26 年 6 月 19 日 (2014.6.19)

【公開番号】特開 2013-98090 (P2013-98090A)

【公開日】平成 25 年 5 月 20 日 (2013.5.20)

【年通号数】公開・登録公報 2013-025

【出願番号】特願 2011-241520 (P2011-241520)

【国際特許分類】

H 0 5 G 1/00 (2006.01)

G 0 1 N 23/02 (2006.01)

G 2 1 K 1/04 (2006.01)

G 2 1 K 1/00 (2006.01)

G 2 1 K 5/02 (2006.01)

G 2 1 K 5/04 (2006.01)

【 F I 】

H 0 5 G 1/00 G

G 0 1 N 23/02

G 2 1 K 1/04 R

G 2 1 K 1/00 A

G 2 1 K 5/02 X

G 2 1 K 5/04 C

【手続補正書】

【提出日】平成 26 年 4 月 28 日 (2014.4.28)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 3 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 3 4 】

【図 1】実施形態に係る X 線照射装置の全体の構成を示す上面図である。

【図 2】実施形態に係る遮蔽体を示す斜視図である。

【図 3】(A) は、第 1 実施形態に係る X 線照射装置において、遮蔽体を透過した X 線ビームの位置と相対線量との関係を示すグラフであり、(B) は、第 1 実施形態に係る X 線照射装置において、遮蔽体を透過した X 線ビームの出射方向から見た形状を示す図である。

【図 4】第 1 実施形態に係る X 線照射装置 1 の要部を示す概略図であり、(A) は上面概略図であり、(B) は側面概略図である。

【図 5】第 1 実施形態に係る X 線照射装置の要部を示す斜視図である。

【図 6】(A) は、第 1 実施形態に係る X 線照射装置における遮蔽体に入射する直前の X 線ビームの出射方向から見た形状を示す図であり、(B) は、第 1 実施形態に係る X 線照射装置における遮蔽体を透過した直後の X 線ビームの出射方向から見た形状を示す図である。

【図 7】第 2 実施形態に係る X 線照射装置の要部を示す概略図であり、(A) は上面概略図であり、(B) は側面概略図である。

【図 8】第 2 実施形態に係る X 線照射装置における偏向磁石の配置例を示す図である。

【図 9】第 2 実施形態に係る X 線照射装置の要部を示す斜視図である。

【図 10】(A) は、第 2 実施形態に係る X 線照射装置における遮蔽体に入射する直前の X 線ビームの出射方向から見た形状を示す図であり、(B) は、第 2 実施形態に係る X 線

照射装置における遮蔽体を透過した直後の X 線ビームの出射方向から見た形状を示す図である。

【図 1 1】第 3 実施形態に係る X 線照射装置の要部を示す概略図であり、(A) は上面概略図であり、(B) は側面概略図である。

【図 1 2】第 3 実施形態に係る X 線照射装置における交流磁石の構成を示す図であり、(A) は斜視図、(B) は側面概略図である。

【図 1 3】第 3 実施形態に係る X 線照射装置により実行される X 線制御処理プログラムの処理の流れを示すフローチャートである。

【図 1 4】第 3 実施形態に係る X 線照射装置の要部を示す斜視図である。

【図 1 5】(A) は、第 3 実施形態に係る X 線照射装置における遮蔽体に入射する直前の X 線ビームの出射方向から見た形状を示す図であり、(B) は、第 3 実施形態に係る X 線照射装置における遮蔽体を透過した直後の X 線ビームの出射方向から見た形状を示す図である。

【図 1 6】第 3 実施形態に係る X 線照射装置において、交流磁石に加える電圧の一例を示すグラフである。

【図 1 7】(A) は、第 4 実施形態に係る X 線照射装置のターゲットの構成を示す正面図であり、(B) は、第 4 実施形態に係る X 線照射装置のターゲットの構成を示す拡大側面図である。

【図 1 8】第 5 実施形態に係る X 線照射装置の要部を示す概略図であり、(A) は上面概略図であり、(B) は側面概略図である。

【図 1 9】第 5 実施形態に係る X 線照射装置の遮蔽体を示す斜視図である。

【図 2 0】(A) は、第 5 実施形態に係る X 線照射装置の要部を示す概略上面図であり、(B) は、第 5 実施形態に係る X 線照射装置の要部の別例を示す概略上面図である。

【図 2 1】(A) は、第 5 実施形態に係る X 線照射装置において、遮蔽体を透過した X 線ビームの位置と相対線量との関係を示すグラフであり、(B) は、第 5 実施形態に係る X 線照射装置において、遮蔽体を透過した X 線ビームの出射方向から見た形状を示す図である。

【図 2 2】第 5 実施形態に係る X 線照射装置において、遮蔽体を透過した X 線ビームのビームプロファイルを示す図である。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 9 1

【補正方法】削除

【補正の内容】